

## スパッタ装置SSPシリーズ 性能比較表

※( )内はオプション要素

モデル		SSP3000Plus	SSP3000	SSP2500G	SSP2000Plus	SSP1000
タイプ		高性能 拡張可能型	高性能型	グローブボックス付 自動マッチャー標準搭載	拡張可能型	成膜方向変更可 エントリーモデル
基本性能	到達圧力	≤5×10 <sup>-5</sup> Pa			≤9×10 <sup>-5</sup> Pa	
	スパッタ方向	スパッタUP				スパッタUP、DOWN、 SIDEに変更可能
	カソード仕様	φ2インチPMC×3基		φ2インチPMC×2基		φ2インチPMC×1基
	スパッタ電源	300W RF電源 1台 (RF、DCを各1台ずつ増設可能)		200W RF電源 1台	300W RF電源 1台	
	整合器	手動マッチングボックス (自動マッチングボックス)		自動マッチングボックス	手動マッチングボックス	
	磁性体材料の成膜	標準仕様は不可(磁性体用カソードマグネットへの交換で対応可能)				
	基板ホルダーサイズ	φ200mm		φ140mm		φ120mm
	最大基板サイズ	φ150mm		φ100mm		
	φ100mm膜厚分布(回転)	±3%以下		±5%以下		
	φ40mm膜厚分布(静止)	±10%以下				
	基板加熱ヒーター温度	MAX300°C (MAX800°C)		MAX300°C	MAX350°C	加熱機構なし
	基板回転速度	5rpm (50rpm高速回転)		2rpm		5rpm
	基板上下機構	50mm自動ストローク		35mm自動ストローク		15mm手動調整
	ターゲット-基板距離(T/S)	50~100mm		60~95mm		55~70mm
	逆スパッタ機構	オプション				なし
チャンバーベーキング	カートリッジヒーター加熱式 100°C未満				オプション	
ロードロック室	トランスファーユニット STR2000接続で対応	オプション 本体に内蔵	グローブボックスで対応	トランスファーユニット STR2000接続で対応	なし	
排気系	メインポンプ	220L/sターボ分子ポンプ		60L/sターボ分子ポンプ		50L/sターボ分子ポンプ
	補助ポンプ	ロータリーポンプ (ドライポンプに変更可能)				
ガス系	プロセスガス導入系				Arガス 1系統 (2系統増設可能)	Arガス 1系統 (1系統増設可能)
寸法重量	外観寸法 W×D×H ※本体のみ、ポンプ含まず	1308×840×1728mm	1418×840×1728mm	750×1081×1918mm	608×800×1827mm	608×608×766mm (スタック配置時)
	本体重量+ポンプ重量	420Kg+27Kg		250Kg+10Kg		82Kg+10Kg

・SSP3000PLUS/SSP2000PLUSは、別売のトランスファーユニットSTR2000と連結することでロードロック室の機能が追加され、更にALD装置やアニール装置、別のスパッタ装置との連結が可能となります。ユニット間の基板搬送は真空中で行われます。

・菅製作所では上記モデルに限らず特注仕様のスパッタ装置も製造しております。お客様のご要望、必要な機能をお申し付けください。